

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年12月28日(28.12.2023)



(10) 国際公開番号

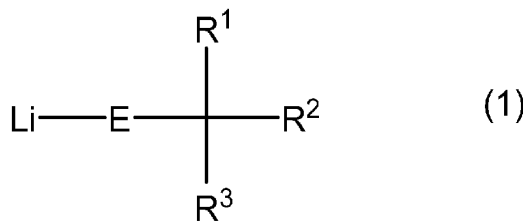
WO 2023/248755 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 16/18 (2006.01) C07F 1/02 (2006.01)
C07C 31/38 (2006.01) C23C 16/455 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/020483
- (22) 国際出願日: 2023年6月1日(01.06.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-098679 2022年6月20日(20.06.2022) JP
- (71) 出願人: レール・リキード・ソシエテ・アノニム・プール・レテュード・エ・レクスプロワタシオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロード (L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE) [FR/FR]; 75007 パリ、カイ・ドルセイ 7 5 Paris (FR).
- (71) 出願人 (SZ についてのみ): 日本エア・リキード合同会社(AIR LIQUIDE JAPAN G.K.) [JP/JP]; 〒1088509 東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 上村 直 (KAMIMURA, Sunao); 〒2390847 神奈川県横須賀市光の丘2番2

- 号 株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ内 Kanagawa (JP). グリア ジェーミ (GREER, Jamie); 〒2390847 神奈川県横須賀市光の丘2番2号 株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ内 Kanagawa (JP). デュサラ クリスチャン (DUSSARRAT, Christian); 〒2390847 神奈川県横須賀市光の丘2番2号 株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人ユニアス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13-9 新大阪MTビル1号館2階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: MATERIAL FOR CHEMICAL VAPOR DEPOSITION, FILM PRODUCTION METHOD, AND FILM

(54) 発明の名称: 化学蒸着用材料、膜の製造方法及び膜



(57) Abstract: The present invention provides a material for chemical vapor deposition, a film production method, and a film which are novel. Provided is a material for chemical vapor deposition represented by formula (1). (In the formula, E is an oxygen atom, a sulfur atom, a selenium atom, or a tellurium atom. R^1 , R^2 , and R^3 , are each independently a hydrogen atom or a linear, branched, or cyclic C1-7 organic group, and at least one of R^1 , R^2 , and R^3 includes a fluorine atom. A case where R^1 , R^2 , and R^3 are all a hydrogen atom is excluded.)

(57) 要約: 新規の化学蒸着用材料、膜の製造方法及び膜を提供する。以下の式(1)で表される化学蒸着用材料。(ここで、Eは、酸素原子、硫黄原子、セレン原子又はテルル原子である。 R^1 、 R^2 及び R^3 は、それぞれ独立して、水素原子又は炭素数1から7の直鎖、分岐若しくは環状の有機基であって、 R^1 、 R^2 及び R^3 の少なくとも一つはフッ素原子を含む。但し、 R^1 、 R^2 及び R^3 のすべてが水素原子であることを除く。)

[続葉有]



WO 2023/248755 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))